# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/010500

International filing date:

08 June 2005 (08.06.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number: 2004-215239

Filing date:

23 July 2004 (23.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 22 July 2005 (22.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 7月23日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-215239

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

JP2004-215239

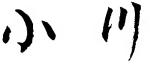
The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

出 願 人

松下電器産業株式会社

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 7月 6日





【書類名】 特許願 【整理番号】 2048260012 平成!6年 7月23日 【提出日】 【あて先】 特許庁長官殿 G06T 15/40 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 若山 順彦 【特許出願人】 【識別番号】 000005821 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100097445 【弁理士】 【氏名又は名称】 岩橋 文雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100103355 【弁理士】 【氏名又は名称】 坂口 智康 【選任した代理人】 100109667 【識別番号】 【弁理士】 内藤 浩樹 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 011305 16,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 ! 明細書 【物件名】 図面 1 【物件名】 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】

9809938

### "【書類名】特許請求の範囲

### 【請求項】】

隠れ面除去法としてZバッファ法を使う、3次元形状を表示する3次元形状描画装置において、

形状を描画する描画部と、

前記描画部で描画された画素データを保存する画像メモリと、

前記描画部で描画された各画素の奥行き値の上位ビットを保存する描画部から高速にアクセスできる上位 Z バッファメモリと、

前記描画部で描画された各画素の奥行き値の下位ビットを保存する描画部から低速にアクセスできる下位乙パッファメモリと、

前記描画部で描画している画素の奥行きとの上位ピットとその位置に以前前記上位乙パッファメモリに書かれていた画素の奥行き値の上位ピットを比較する上位乙パッファ比較部と、

前記描画部で描画している画素の奥行きとの下位ピットとその位置に以前前記下位Zバッファメモリに書かれていた画素の奥行き値の下位ピットを比較する下位Zバッファ比較部とをもち、

まず、描画を始める前に前記上位 Z バッファメモリと前記下位 Z バッファメモリに 初期値をいれ、形状を描画する際に、描画部により計算された各画素の隠れ面除去を行う際に、奥行き値の上位ビットを前記上位 Z バッファメモリに以前書かれた値と比較し、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値がより近ければ前記画像メモリに画素値を、前記上位Zバッファメモリに新たな奥行き値の上位ビットを、前記下位Zバッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込み、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値がより遠ければそのまま次の処理に 移り、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値が同じであれば、奥行き値の下位ビットを前記下位乙バッファメモリに以前書かれた値と前記下位乙バッファ比較部で比較し

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値がより近ければ前記画像メモリに画素値を、前記下位乙バッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込み、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値がより遠ければそのまま次の処理に 移り、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値が同じであればそのまま次の処理に 移る3次元形状描画装置。

### 【請求項2】

請求項1に記載の3次元形状描画装置において、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値が同じで、奥行き値の下位ビットを前記下位乙パッファメモリに以前書かれた値と前記下位乙パッファ比較部で比較し、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値が同じであれば前記画像メモリに画素値を、前記下位 Z バッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込む 3 次元形状描画装置。

### 【請求項3】

隠れ面除去法として Z バッファ法を使う、3 次元形状を表示する3 次元形状描画方法において、

フレームごとに、

画素を保持するフレームメモリを消去するステップと、

奥行き値の上位ピットを保持する上位乙バッファメモリを消去するステップと、

奥行き値の下位ビットを保持する下位乙バッファメモリを消去するステップと、

形状データをもとに描画データを作成するステップと、

作成された描画データの奥行き値の上位ビットを過去に描画された画像の奥行き値の上位ビットと比較するステップと、

`前記の上位ピット比較ステップにおいて、新たに描画する画像の上位ピットを過去に描画された画像の奥行き値を比較してより近い場合新たに描画する画像をフレームメモリと上位 Z バッファメモリに書き込むステップと、

前記の上位ビットを比較するステップにおいて、新たに描画する画像の上位ビットが過去に描画された画像の奥行き値と同じ場合には新たに描画する画像の下位ビットと過去に描画された画像の奥行き値と比較してより近い場合新たに描画する画像をフレームメモリと上位 Z バッファメモリと下位 Z バッファメモリに書き込む ステップとによる 3 次元形状描画方法。

# 【請求項4】

請求項3に記載の3次元形状描画方法において、

上位ビット比較ステップにおいて新たに描画する画像の奥行き値の上位ビットが上位Zバッファメモリに入っている過去に描画された画像の奥行き値と同じときかつ下位の奥行き値が下位Zバッファメモリに入っている過去に描画された画像の奥行き値と同じとき新たに描画する画像をフレームメモリと上位Zバッファメモリと下位Zバッファメモリに書き込むステップを持つ3次元形状描画方法。

### 【請求項5】

請求項1または請求項2に記載の3次元形状描画装置において、画像の奥行き値を必ず上位Zバッファメモリの値が全ビット0にならないようにし、

乙パッファのクリアにおいて、上位乙パッファメモリのみのクリアにした、

3次元形状描画装置。

### 【請求項6】

請求項3または請求項4に記載の3次元形状描画方法において、上位Zバッファメモリに書き込む画像の奥行き値が必ず全ビット0にならないようにし、下位Zバッファメモリのクリアのステップを省いた、

3次元形状描画方法。

# 【請求項7】

請求項1、請求項2または請求項5に記載の3次元形状表示装置において、形状を描画する描画部を、奥行き値計算部と、輝度・マテリアル値計算部に分け、

まず、前記奥行き値計算部により奥行き値を計算し、先に奥行き値による描画判定を行い、前記フレームバッファに新たな値を書き込まなければならないときのみ、輝度・マテリアル値計算部により値を計算する、

3次元形状描画装置。

### 【請求項8】

請求項1、請求項2または請求項5に記載の3次元形状描画装置において、

描画部を二段に分け、早期隠れ面除去描画部と、晩期隠れ面除去描画部とにわけ、

早期隠れ面除去描画部においては、画素の生成と上位乙パッファメモリとの比較を行い、フレームパッファや乙パッファに書き込むべき画素か、書かなくてもよい画素か、下位乙パッファメモリとの比較を行う画素かのフラグをつけて、晩期隠れ面除去処理部に送り、晩期隠れ面除去部では、下位乙パッファメモリとの比較を行う画素であるというフラグがついていた場合、下位乙パッファメモリと比較し、書き込むべき画素である場合と、前記早期隠れ面除去描画部から書き込むべき画素であるというフラグがついていた場合、当該画素をフレームパッファメモリと上位乙パッファメモリと、下位乙パッファに書き込む3次元形状描画装置。

### 【書類名】明細書

【発明の名称】3次元形状描画方法ならびに装置

# 【技術分野】

[0001]

本発明は、視点からの奥行き値を用いた乙パッファ法を隠れ面除去法として使う3次元形状表示装置に関するものである。

# 【背景技術】

[0002]

従来の3次元形状表示装置としては、隠れ面除去方式として、Zバッファ方が以前から使われており、Zバッファ法を高速化する技術として、画素ごとに1ビットのフラグメモリを持つ方法(たとえば特許文献1)や、複数の画素の一番遠い奥行き値と一番近い奥行き値を持つ縮退したZバッファを持つ方法(たとえば特許文献2)などがあった。図2、図3は特許文献2に示された従来のZバッファアクセス低減法を示したものである。

### [0.003]

図2において、画面201は画面の構成をMXNの領域に分割したものである。ブロック202は画面201のKXLのピクセルで構成されるひとつのブロックである。MAXZ203は各々のブロック202における最大のZ値を保持するメモリで、すべてのブロックにひとつずつ存在する。MINZ204は各々のブロック202における最小のZ値を保持するメモリで、すべてのブロックにひとつずつ存在する。また、図3において、画像供給部301はポリゴンのデータを画像合成部302に供給し、画像合成部302は、ポリゴンデータをピクセルデータに変換するピクセル描画部303、ピクセルデータの奥行き値とMAXZ203とMINZ204をもつZRバッファ305と、すべてのZ値をもつZメインバッファ306により描画すべきピクセルを保持するフレームバッファ307と、プレームバッファ307の画素データを実際の輝度データに変換するバレット回路308からなり、バレット回路308の出力をディスプレイ309に画像を供給する。

### [0004]

この方式では、新たに描画する際に、画面 201におけるプロック 202の MAXZ203、 MINZ204と、これから描画しようとする画素の Z値とを比較し、新たな Z値が MAXZ203 より大きかった場合、描画を取りやめ、 MINZ204 より小さかった場合、Z メインバッファ 306 に新たな Z 値を、フレームバッファ 307 に新たなど 20 を新たな 20 位により置き換え、これから描画しようとする画素の 20 位が 20 を新たな 20 の間なら、 20 というではる 20 の 20 に入っている 当該位置のピクセルの 20 位と比較し、これから描画しようとしている 画素の 20 位の方が小さければ新たな 20 位に置き換え、 当該プロック 20 2 に属するすべての 20 位を 20 といっての 20 の 20 の

### [0005]

このようにして、Zメインバッファ306へのアクセスをプロック202単位のZMAX203、ZMIN204の間のときのみにすることにより、アクセス量を低減することができる。

【特許文献 1】 特開昭 6 2 - 4 2 2 8 1 号公報

【特許文献2】特開平8-161526号公報(第5-7頁、図1、図4)

### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

### [0006]

しかし、このような3次元形状描画装置では、ビクセルごとに乙メインバッファを読み出す必要をなくすことができるようにはなったが、MAXZのアップデートのために、ブロックの乙すべてを読み出し、比較し最大値を出す必要がある。また、MAXZの計算をしている最中は次のピクセルの処理ができないため、処理が止まってしまう。また、MAXZ、MINZのために余計なメモリを持つ必要がある。また、乙メインバッファのクリ

アとMAXZ、MINZのメモリのクリアが毎回必要となる。

# [0007]

本発明はこのような課題を解決するものであり、古典的な Z バッファ方と同じメモリ容量で、描画する物体と以前描画されていた物体の距離が遠い場合は隠れ面除去の速度が速く、近い場合は隠れ面除去の速度が遅く処理され、また、 Z バッファクリアをメモリの部分的な消去で可能ならしめ、隠れ面除去を行った後の画素のみ描画計算を行うことで、 低い演算性能でも多くの描画を行うことができる 3 次元形状描画装置を提供するものである

### 【課題を解決するための手段】

### [0008]

上記課題を解決するために、本発明は、奥行き値を保存するZバッファを、奥行き値の上位ピット保存する上位Zバッファと、下位ピットを保存する下位Zバッファにわけることにより、新たに描画する物体の上位ピットのみ上位Zバッファを使ってあらかじめ比較することによって、下位Zバッファにアクセスすることなく、大多数の描画を行うことができる。また、本発明は、物体の奥行き値を限ることにより、下位Zバッファをクリアすることなく、上位ZバッファをクリアするだけでZバッファをクリアすることができる。また、本発明は、奥行き値の上位ビットの比較を描画部から分離することにより、輝度値の計算を描画されている物体より近い物体を描画計算するときのみに限る。

### 【発明の効果】

# [0009]

以上のように本発明では、Zバッファを上位Zバッファと下位Zバッファに分けることで、アクセス量の低減のみならず、上位Zバッファに高速なSRAMメモリやASIC内蔵メモリを使うことができ、より高速な描画を行うことができる。また、上位Zバッファのみのクリアでよいため、メモリアクセス量の低減と高速化をより進めることができる。また、DSPのような演算器で行う場合、上位Zバッファの比較を行ったのち、輝度の計算等を行うため、同一の演算性能でよりたくさんの物体を描画することができる。

### 【発明を実施するための最良の形態】

### [0010]

以下本発明の実施の形態について、図面を参照しなから説明する。

### $[0\ 0\ 1\ 1\ ]$

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1における3次元形状描画装置の隠れ面除去装置を説明した図である。

### [0012]

図1において、101はボリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部、102は画像メモリ103に入っている各画素の奥行き値の上位8ビットが入っている上位Zバッファメモリ、103は描画部101で描画され、隠れ面除去された画像が入っている画像メモリ、104は画像メモリ103に入っている各画素の奥行き値の下位16ビットが入っている下位Zバッファメモリ、105は奥行き値の上位8ビットを比較する上位Zバッファ比較部、106は奥行き値の下位16ビットを比較する下位Zバッファ比較部、107はボリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部101にあって、画素の奥行き値を計算する奥行き値計算部、108はボリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部101にあってピクセルの明るさである輝度値や表面の質感であるマテリアル値を計算する輝度・マテリアル計算部、109は上位Zバッファメモリ102を初期化する下位Zバッファクリア部、110は下位Zバッファメモリ103を初期化する下位Zバッファクリア部である。

### [0013]

図4は図1における上位Zバッファメモリ102、下位Zバッファメモリ104に図形401と図形402の情報を描いた様子を示す。ピクセル403は本実施の形態説明のための、上位Zバッファメモリ102と下位Zバッファメモリ104のある同一座標のピク

# [0014]

かかる構成により、3次元形状データによる画像を生成するためには、まず上位Zバッ ファクリア部109と下位2バッファクリア部110で上位2バッファメモリ102と下 位Zバッファメモリ104を初期値つまり、視点から見たときの最遠の値で塗りつぶす。 ここでは仮に最遠の値を十六進数で00000Hの24ビットの精度の値とする。図4 では、上位乙パッファメモリ102は上位8ピット、下位乙パッファメモリ104は16 ビットなので、各々00Hと0000Hで初期化する。なお、専用の上位乙バッファクリ ア部109や下位Zバッファクリア部110を持たずに描画部101をもちいて最遠値0 0000日で値を埋めてもよい。次に、処理すべき3次元形状である、図形401や図 形402を描画部101で処理するときに、はじめに3次元形状の各々のピクセルの奥行 き値Znowを奥行き値計算部107で計算する。上位Zバッファ比較部105が、計算 された奥行き値Znowの上位8ビットZnowHIと、そのピクセルの位置に対応する すでに描画されている画像の奥行き値の上位8ビットZoldHlを上位Zバッファメモ リ102から読み出し、ZnowHI>ZoldHIならは、輝度・マテリアル計算部1 08でピクセルの輝度値等Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値Znowとともに 、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ピットZnowHIは上位 乙パッファメモリ102に、Znowの下位16ビットZnowLOは下位Zバッファメ モリ104に書き込む。

# [0015]

ZnowHI=ZoldHIならは、下位Zバッファ比較部106があらためてZnowの値の下位16ビットZnowLOの値と、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の下位16ビットZoldLOを下位Zバッファメモリ104から読み出し、ZnowLO>ZoldLOならは、輝度・マテリアル計算部108でピクセルの輝度値等Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値Znowとともに、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ビットZnowHIは上位Zバッファメモリ102に、Znowの下位16ビットZnowLOは下位Zバッファメモリ104に書き込み、ZnowLO  $\le ZoldLO$ ならば輝度・マテリアル計算部108での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

# [0016]

ZnowHI<ZoldHIならは、輝度・マテリアル計算部108での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

### [0017]

ピクセル 4 0 3 を例に挙げると、はじめに上位 Z バッファクリア部 1 0 9 と下位 Z バッファクリア部 1 1 0 で各々の初期値 0 0 H、 0 0 0 0 Hで初期化される。次に、図形 4 0 1 を描画する際に図形 4 0 1 のピクセル 4 0 3 の位置の奥行き値の上位 8 ピット  $Z_{401HI}$  を上位 Z バッファメモリ 1 0 2 に入っている初期値 0 0 Hと比較し、 $Z_{401HI}$  が書き込まれ、下位 Z バッファメモリ 1 0 2 のピクセル 4 0 3 には  $Z_{401HI}$  が書き込まれ、画像 Z モリ 1 0 1

# $\{0018\}$

なお、本発明では輝度・マテリアル計算部108の計算は奥行き値の比較が終わって必要なときのみ計算するようになっているが、奥行き値計算部107での計算と同時に行っ

. てもよい。また、奥行き値計算部107での処理、上位乙パッファ比較部105での処理、下位乙パッファ比較部106での処理、輝度・マテリアル計算部108での処理をパイプライン的に処理してもよい。

# [0019]

なお、ピクセルの奥行き値を24ビットの16進数で01000Hを一番奥にし、3次元形状がそれより近くなるように描画部101へ入る形状データを制御することにより、上位Zバッファクリア部109が上位Zバッファメモリ102を8ビットの16進数で010Hの値でのクリアのみで、下位Zバッファクリア部110による下位Zバッファメモリ104のクリアを省き、メモリアクセス量を減らすことができる。

# [0020]

なお、上位乙パッファ比較部105の上位乙パッファメモリ102へのアクセスは、下位乙パッファ比較部106の下位乙パッファメモリ104へのアクセスに比べて頻度が少なくかつ、乙の値のうちの上位8ピットのみでよいため、高速な小容量のメモリを使って、アクセス量の低減以上に高速化してもよい。

# [0021]

なお、この実施の形態では一例として上位奥行き値を8ビット、下位奥行き値を16ビットの合計24ビットの精度としたが、合計のビット数ならびに、上位、下位の分け方は任意でよい。

### [0022]

## (実施の形態2)

図5は、本発明の実施の形態2における3次元形状描画装置の隠れ面除去方法を説明したフローチャートである。図6は、本発明の実施形態2における3次元形状描画装置を説明したものである。

# [0023]

図5において、501は上位 Z バッファメモリ102と画像メモリ103を初期化する上位 Z バッファ・画像メモリクリアステップ、502は下位 Z バッファメモリ104を初期化する下位 Z バッファクリアステップ、503はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画ステップ、504は描画ステップ503でえられたポリゴンの各ピクセルにおける 奥行き値の上位 8 ビットを比較する上位 Z バッファ比較ステップ、505は 単行き値の下位 16 ビットを比較する下位 Z バッファメモリ104、画像メモリ103に書き込む、描き戻しステップである。

# [0024]

図6において、101はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部。601は 奥行き値の上位ピットの1画面分を持っている上位Zバッファメモリ102を記録する高 速グラフィックスメモリ、602は奥行き値の下位ピットの1画面分を記録する下位Zバッファメモリ104と画面のピクセルデータを記録する低速グラフィックスメモリである

### [0025]

かかる構成により、3次元形状データによる画像を生成するためには、1画面ごとに、上位Zバッファメモリ102を視点から見た最遠の値で、画像メモリ103を初期値で塗りつぶす上位Zバッファ・画像メモリクリアステップ501を描画部101を使って行い、次に下位Zバッファメモリ104を視点から見た最遠の値で塗りつぶす下位Zバッファメモリクリアステップ502を描画部101を使って行う。

### [0026]

次に、3次元形状の各々のピクセルの奥行き値Znowを描画ステップ503で計算し、上位Zパッファ比較ステップ504で計算された奥行き値Znowの上位8ピットZnowHIと、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の上位8ピットZoldHIを上位Zパッファメモリ102から読み出し、ZnowHI>ZoldHIつまり、現在描画しているピクセルのほうが近いのならば、描き戻しステップ5

「06に飛びピクセルの輝度値等 Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値 Znowとともに、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ピット ZnowH Iは上位 Zバッファメモリ102に、 Znowの下位16ピット ZnowL Oは下位 Zバッファメモリに書き込む。

### [0027]

ZnowHI=ZoldHIならば、下位Zバッファ比較部106があらためてZnowの値の下位16ビットZnowLOの値と、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の下位16ビットZoldLOを下位Zバッファメモリ104から読み出し、ZnowLO>ZoldLOならば、描き戻しステップ506でピクセルの輝度値等Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値Znowとともに、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ビットZnowHIは上位Zバッファメモリ102に、ZnowDices ZnowDices Zno

### [0028]

ZnowHI<ZoldHIならは、下位Zバッファ比較ステップ505と描き戻しステップ506での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

# [0029]

なお、本発明では描き戻しステップ506の計算は奥行き値の比較が終わって必要なと きのみ計算するようになっているが、描画ステップ503での計算と同時に行ってもよい

# [0030]

なお、ビクセルの奥行き値を24ビットの16進数で01000Hを一番奥にし、3次元形状がそれより近くなるように描画ステップ503へ入る形状データを制御することにより、上位Zバッファ・画像メモリクリアステップ501が上位Zバッファメモリ102を8ビットの16進数で00Hの値でのクリアのみで、下位Zバッファクリアステップ502による下位Zバッファメモリ104のクリアを省き、メモリアクセス量や処理量を減らすことができる。

# [0031]

なお、上位 Z バッファメモリ 1 0 2 へのアクセスは、下位 Z バッファメモリ 1 0 4 や画像メモリ 1 0 3 へのアクセスに比べて頻度が多くかつ、 Z の値のうちの上位 8 ビットのみでよいため、高速な小容量の高速グラフィックメモリ 6 0 1 を使い、下位 Z バッファメモリ 1 0 4 や画像メモリ 1 0 3 を大容量だが低速な低速グラフィックスメモリ 6 0 2 に割り当て、コストアップを最低限にしつつ、アクセス量を低減し高速化してもよい。

### [0032]

なお、この実施の形態では一例として上位奥行き値を8ビット、下位奥行き値を16ビットの合計24ビットの精度としたが、合計のビット数ならびに、上位、下位の分け方は任意でよい。

### 【産業上の利用可能性】

# [0033]

本発明にかかる3次元形状描画装置は、隠れ面除去法としてZバッファ法を用い、奥行き値の上位ピットを先行的に比較することでバスアクセス量を減じ、限られたバス幅でも高速に3次元形状を描画するのに有効である。

# 【図面の簡単な説明】

### [0034]

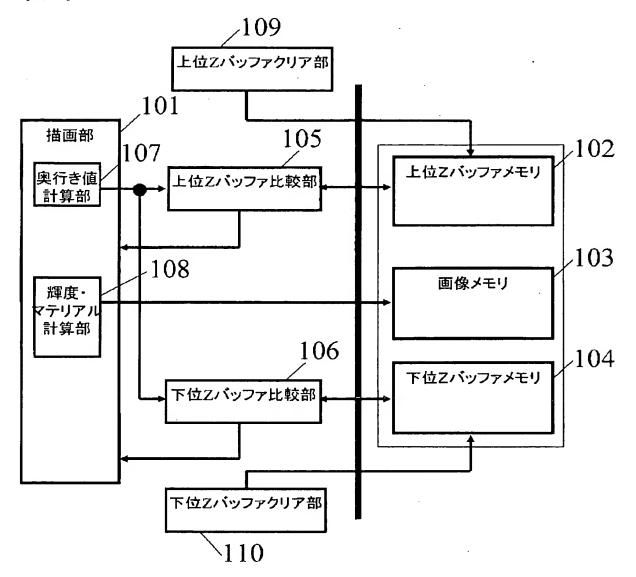
- 【図1】本発明の実施の形態1を説明する図
- 【図2】従来の方法を説明する図
- 【図3】従来の方法を説明する図
- 【図4】本発明の実施の形態1を説明する図
- 【図5】本発明の実施の形態2を説明する流れ図

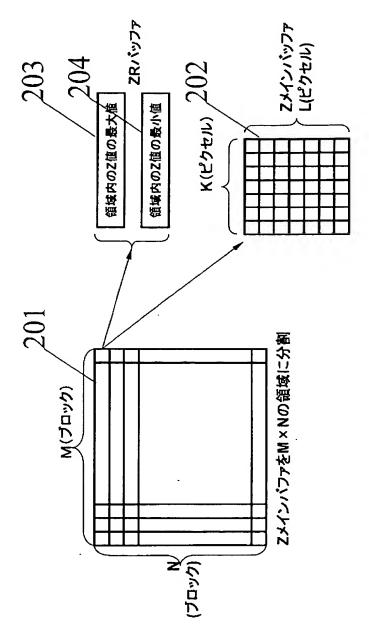
# 【図6】本発明の実施の形態2を説明する図

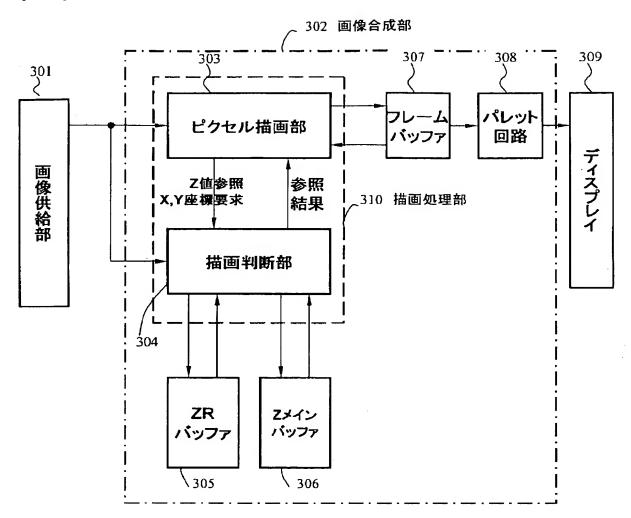
# 【符号の説明】

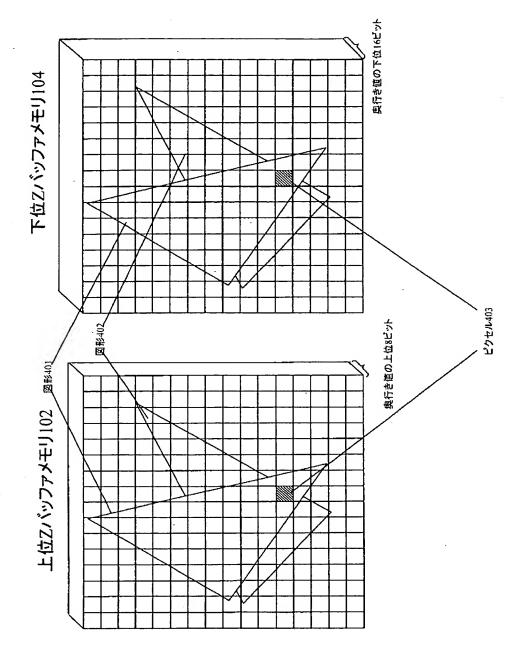
```
[0035]
```

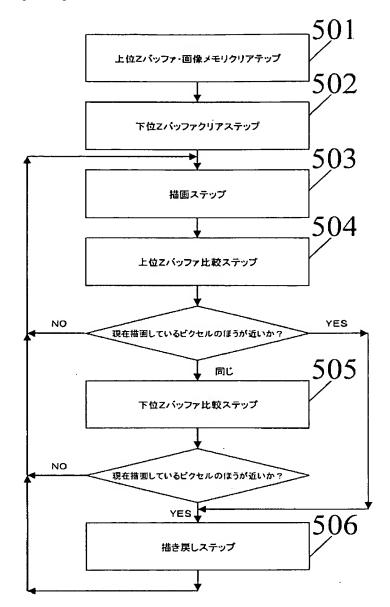
- 101 描画部
- 102 上位 Z バッファメモリ
- 103 画像メモリ
- 104 下位乙パッファメモリ
- 105 上位Ζバッファ比較部
- 106 下位乙パッファ比較部
- 107 奥行き値計算部
- 108 輝度・マテリアル計算部
- 109 上位乙パッファクリア部
- 110 下位乙パッファクリア部
- 201 M×Nの領域に分割された画面
- 202 画面を分割したブロックの一つ
- 203 プロック内の乙値の最大値
- 204 プロック内の Z値の最小値
- 301 画像供給部
- 302 画像合成部
- 3 0 4 描画判断部
- 305 ZR/1/27
- 306 Ζメインバッファ
- 307 フレームバッファ
- 308 パレット回路
- 309 ディスプレイ
- 3 1 0 描画処理部
- 401,402 図形
- 403 図形を構成する1ピクセル
- 501 上位乙パッファ・画像メモリクリアステップ
- 502 下位 Z バッファクリアステップ
- 503 描画ステップ
- 504 上位乙パッファ比較ステップ
- 505 下位乙パッファ比較ステップ
- 506 描き戻しステップ
- 601 高速グラフィックメモリ
- 602 低速グラフィックメモリ

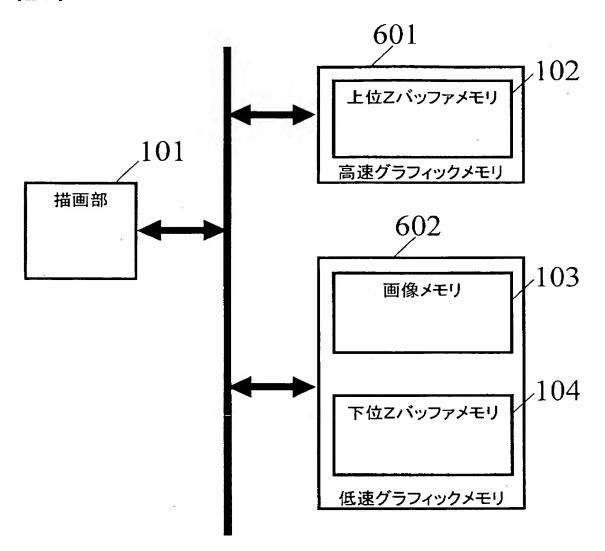












'【書類名】要約書

【要約】

【課題】限られたバスバンド能力で高精細な3Dグラフィックス映像を作成することが難しい。

【解決手段】カメラと物体間の距離を蓄積する Z バッファを、精度の荒い Z バッファと、精度の細かい Z バッファとに分離することで、距離の遠いもの同士の比較を精度の荒い Z バッファで比較し、その荒い精度の Z バッファで比較することにより、少ないバスバンド幅で隠れ面除去を行うことが出来る。 【選択図】図 1 000000582119900828

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地松下電器産業株式会社